Longitudinal Ion Beam Chopper on Einzel Lens for KEK Digital Accelerator

Teruo Arai¹, Toshikazu Adachi^{1,2}, Leo Kwee Wah², Ken Takayama^{1,2,3}, Akira Tokuchi^{1,4}

¹KEK, Tsukuba, Ibaraki, Japan

²The Graduate University for Advanced Studies, Hayama, Kanagawa, Japan

³Tokyo Institute of Technology, Nagatsuda, Kanagawa, Japan

⁴Pulse Power Japan Lab., Kusatsu, Shiga, Japan

KEK デジタル加速器用 Einzel レンズ縦軸方向ビームチョッパー

Abstract

In the pulse mode ECR operation, it takes a time duration of msec to achieve a saturation in the plasma density. An injection pulse length of 5 µsec in the KEK digital accelerator is expected, because it has a revolution time period of 12 µsec for a low energy ion, where one turn injection is employed. A beam chopper is required. A longitudinal chopper called "Einzel lens chopper" has been newly developed for this purpose. The function of chopping is implemented in the Einzel lens that is placed right after the ion source for beam optics matching downstream. The longitudinal chopper is realized by controlling the Einzel lens middle-electrode potential to gate the ion beam stream. Marx Generator is used to generate a negative high voltage pulse which is added to the positive high voltage for blocking an ion beam. All devises are installed near the ion source and just upstream the post-acceleration of 190 kV. X-ray, secondary electrons or out gassing can be minimized. These features are big advantage. Finite time periods of rising/falling of the chopper pulse voltage induces a large momentum deviation in the chopped pulse head/tail. Fortunately, its size is largely reduced due to the post-acceleration then the chopper is being operated very stably in beam commissioning.

1. 緒言

KEK 旧 500MeV ブースターリングを改装して、 RF 加速装置を誘導加速装置に置き換え、誘導加速 シンクロトロン[1,2]として動作するデジタル加速器 [3,4]が運転を開始した[5,6] (図1参照)。



図1:デジタル加速器の概略

イオン源はパルスモードで動作する永久磁石 xband ECR イオン源である[6]。取り出し電圧 10 kV で引き出されたイオンは 190 kV の後段加速を受け、 電荷数・運動量選別磁石で選別される。Low Energy Beam Transport (LEBT)を経由して、デジタル加速器 リングに入射される。入射には静電キッカーが用い られる。入射前に 20 kV まで印加されたキッカー電 圧は入射したビームパルスが 1 ターンして戻って来 るまでにアース電圧に降圧される。有限な falling 時間を考慮して入射されるビームパルス長は 5 μsec に決められた。

パルスモード ECR 方式の特性として、プラズマ の成長に msec オーダーの時間を必要とする。この 事情からビームチョッパーが必須となる。



図2:イオン源構成の概略

ビームチョッパーとして通常の横方向ではなく、 縦方向(ビーム軸方向)にチョップする方法が考案 された。ECR イオン源と 200 kV 加速管の間に置か れた横方向マッチング用 Einzel レンズにこの機能を 担わせた(図 2 参照)。製作されたチョッパーとそ の動作特性については論文[7]に詳しいが、ここでは そのアウトラインを紹介する。

収束用として不可欠な Einzel レンズとの共用で チョッパーヘッドは不要になり、コストの大幅減に つながる。又、最小エネルギーでビームハンドリン グを行う事により X 線や二次電子エネルギーが小 さくアウトガスも低く抑えられる等のメリットが強 調される。

Einzel レンズと Longitudinal Gating のア イデア

Einzel レンズは、イオン源引き出し電極の直下に 置かれる3個の円筒状の電極で、中間電極を正電圧 に印加し、前後の電極はアース電位である。中心か ら外れたイオンは電極ギャップを通過する際に中心 からの距離依存性を持った発散と収束の力を順次受 け、結果的に収束される。通常下流 LEBT との matching 最適化の条件から中間電極の電位は決めら れる。

この中間電極の電位を ECR イオン源からの引き 出し電圧ないし、それより大きな電圧に維持すると 下流域へのイオン流をブロックできることは容易に 想像できる。即ち、この中間電極電位の制御によっ てイオン流のコントロールが可能になる筈である。 これを longitudinal gating と呼ぼう。この中間電極電 位を変化させた場合のイオンの動きについてシミュ レーションした結果を図3に示す。



図 3: Einzel Lens 域の IGUN シミュレーション

13 kV でイオン流が完全にブロックされる事が示された。この予想に沿い、ヘリウムと窒素の1価イオンを用いた実験が行われた。イオン源下流に置いたファラデーカップによりイオン電流を測定したところ、13 kV を超えたところでイオン電流はゼロになり、イオンビームが完全にブロックできることが確認された(図4参照)。



この Longitudinal gating をµsec オーダーで行えば、 結果としてそれがここで求めるチョッパーとなる。 即ち、中間電極電位を、通常は完全にイオン流をブ ロック出来る電位に保持し、イオンが必要な時間幅 のみ横方向収束に必要な電位(今回のケースでは 8 kV)まで落としてやれば良い。この目的のために 次節で解説する負電圧の矩形パルスを生成する Marx Generator を製作した。

3. MOSFET Marx Generator

Einzel レンズ中間電極には、高圧電源から供給さ れるブロック電圧がコンデンサにチャージされた形 で印加され、そのコンデンサとグランド間に4段構 成の Marx Generator が接続される。各段のコンデン サーには負極性の高圧が供給され、常時並列充電さ れている。各スイッチ(MOSFET)を同時にオンす ることで直列放電させ、ブロック電圧に重畳される。 MOSFET のオン抵抗と等価に設定されたスイッチを 仮定し、図 5(上)に示した等価回路のミュレー ションを行った。



図5:重畳電圧のシミュレーション結果

波形の立下り立ち上がりおよび平坦度ともに十分な 特性が予想された。製作された Marx Generator はコ ンデンサバンクと耐圧 4 kV、 電流パルス最大 3 A の MOSFET が 3 並列接続等を中心に組まれており、 それを 4 段直列に構成されている。

4. 電圧重畳波形とビームチョッパー

これらの装置一式をイオン源下流に組み込んだ後、 電気特性およびビームチョップ性能について検証し た。電気的には、シミュレーション回路にも含まれ ている抵抗分圧回路を用いて観測された。結果を図 6 に示す。波形の形状及び平坦度ともにシミュレー ション結果と良く一致しており、概ね想定どおりの 特性が得られた。

一方、チョップされたビーム電流は 190 kV の
 post-acceleration を経て分析磁石下流 2.5 m に置かれ

たファラデーカップで測定された。実験では 5 msec 長のイオン源からのパルス(図 7 参照)の異なるタ イミングでチョップされた。イオンビーム電流パル ス波形を図 8 に示す。



図 6: Marx Generator 重畳電圧の実測結果 CH2:各スイッチへのトリガー波形、CH1:直列放 電された-5 kV をブロック電圧である+12.5 kV に重 畳した中間電極電圧波形。





図 7:パルスモード運転の ECR イオン源(繰り返し 10 Hz、5 msec 幅、700W のマイクロ波を導入)から 引き出されたイオンビーム電流



図 8:マイクロ波を増幅する TWT アンプのトリ ガー信号から 0.6、1、3 msec 後に Marx Generator を トリガーしたビームチョップ波形

図8の波形の立ち上がり立下りのなまりは、ファラ デーカップ測定系の回路定数(浮遊容量、同軸ケー ブル長等からなる)に起因するものである。ファラ デーカップ測定系を通して得られた信号から逆問題 の解として入力ビーム信号が求められる。一方、 チョッパー電圧の波形(図6)とビーム電圧とファ ラデーカップで補足出来る電流との直接的関係を示 す特性曲線(図4)から有限なアパーチャーを持っ たファラデーカップまで到達しえるビーム電流波形 が得られる。これらを比較したものが図9である。 これらは詳細な解析で判明した[8,9]。



図 9:逆問題の解として得られたビーム波形(青)、 特性曲線とチョッパーパルス電圧の時間変動を考慮 して求められる予測ビーム電流波形(赤)

5. チョッパー電圧パルスの遷移時間と運 動量空間広がりへの影響

チョッパー電圧パルスは完全な矩形波形ではない。 有限な時間で立ち上り、立ち下がる。この時間を遷 移領域時間と呼ぼう。チョッパー領域を通過するイ オンの所謂トランジェント時間はチョッパー電圧パ ルス幅(5 μ sec)に比較して短いが、立ち上がり、 立下り時間に比較すると長い。この結果、遷移領域 時間帯にチョッパー域を通過するイオンはチョッ パー領域通過後にエネルギー収支が0にならない。 チョッパー通過に関する詳細なビームシミュレー ションにより、チョップされたイオンビームの運動 量空間での広が入りが求められた[8,9]。図 10 にそ れを示す。チョップされたパルスの Head と Tail に 大きなモジュレーションが発生している事が分かる。 横方向のチョッパーの場合には横方向位相空間にこ の種のサイド効果が認められるが、縦方向チョッ パーの場合は縦方向にこの効果が表れる。完全な矩 形のチョッパー電圧波形は望めたいので、これは普 逼的縦方向チョッパー特性といえる。



図 10: チョッパー通過後の位相空間(t, *Δp/p*)での イオンの拡がり

幸い、この運動量空間のモジュレーションは後段加 速前に発生する。定電圧の後段加速により、このモ ジュレーションは大幅に緩和され、KEK-DA への入 射段階では実際上問題にならないレベルまで下がる。

5. まとめ

MOSFET Marx Generator 駆動 Einzel レンズチョッパーの利点と特徴は以下の様に纏められる。

- 低エネルギー段階でのビーム処理のため付随 する弊害が軽微
- チョップされたパルスの Head と Tail に対応するチョッパーパルス電圧の立ち上がり・立下り時間帯にチョップされる粒子には運動量拡がりが生じる
- 専用のチョッパーヘッドは不要
- 特別な高圧制御の部品を必要としない。
- 結果的に同目的の横方向チョッパーと比較してそのコストは十分の一程度である

今後の研究開発の課題は;

- 電圧波形の切れと平坦度の改善
- ECR イオン源以外のレーザーアブレーション イオン源等の他イオン源との組み合わせ実証

現在このチョッパーは安定にデジタル加速器ヘビー ムを供給している[10]。

謝辞

江偉華教授(長岡技科大)がパワー半導体利用の Marx Generator の情報をもたらした。高木昭氏 (KEK)には Marx Generator の負極性高圧をコンデン サ経由で重畳する方法に関して多くの協力を頂いた。 一連の研究は科学研究費基盤研究(A) (23240082)によってサポートされた。

参考文献

[1] K. Takayama, Y. Arakida, T. Dixit, T. Iwashita, T. Kono, E. Nakamura, K. Otsuka, Y. Shimosaki, K. Torikai,

M. Wake, "Experimental Demonstration of the Induction Synchrotron" *Phys. Rev. Lett.* **98**, 054801-4 (2007).

[2] K.Takayama and R.Briggs "Induction Accelerators" (*Eds.*) (Springer, 2010).

[3] K. Takayama, Y. Arakida, T. Iwashita, Y. Shimosaki, T. Dixit, and K. Torikai, "All-ion accelerators: An injector-free synchrotron" *J. of Appl. Phys.* 101, 063304-8 (2007) Patent No. 3896420, PCT/JP2006/308502 (2006).
[4] T. Iwashita, T. Adachi, K. Takayama, T. Arai, Y.

Arakida, M. Hashimoto, E. Kadokura, M. Kawai, T. Kawakubo, Tomio Kubo, K. Koyama, H.Nakanishi, K. Okazaki, K. Okamura, H. Someya, A. Takagi, A. Tokuchi, K. W. Leo, and M. Wake, "KEK Digital Accelerator" *Phys. Rev. ST-AB* **14**, 071301 (2011).

[5] T. Iwashita *et al.* "KEK デジタル加速器の運転開始" 第 8 回加速器学会 TULH04 (2011).

[6] Leo Kwee Wah, K.Takayama, T.Arai, K.Okazaki, A.Takagi, T.Adachi, K.Koyama, M.Wake and Y.Arakida, "Permanent Magnet ECRIS for the KEK Digital Accelerator" *19th International Workshop on ECR Ion Sources*, August 23-26, 2010 Grenoble, France, TUPOT15 (2010).

[7] T. Adachi, T. Arai, K. W. Leo, K. Takayama, and A. Tokuchi, "A solid-state Marx generator driven Einzel lens chopper" *Rev. Sci. Inst.* 82,083305(2011).

[8] Leo Kwee Wah, "Ion Beam Handling by an Einzel lens chopper for the KEK digital accelerator" Ph. D Thesis, The Graduate University for Advanced Studies

[9] Leo Kwee Wah, T. Adachi, T. Arai, and T. Takayama, "Einzel Lens Chopper and Behavior of the Chopped beam in the KEK Digital Accelerator" submitted to *Phys. Rev. ST-AB* (2012).

[10] K. Takayama et al., "KEK Digital Accelerator and Recent Beam Commissioning Result" Proceedings of HIAT 2012, TUC02 (2012).